



Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr. : 5505/85 (51) Int. Cl. 4: G 03 F 1
(22) Indleveringsdag:.... 28 nov 1985
(24) Løbedag:..... 28 nov 1985
(41) Alm. tilgængelig:.... 29 maj 1987
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr. :... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: -
(71) Ansøger: FERD. *RUEESCH AG, St. Gallen, CH
(72) Opfinder: Heinz *Keller,, CH
Heinz *Brockner,, CH
Martin *Lehner,, CH
(74) Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S, Adelgade 15, 1304,
København K

- (54) Fremgangsmåde og anordning til fremstilling af væv til serigrafi
(57) Sammendrag

5505-85.

SAMMENDRAG

Væv til serigrafi fremstilles ved, at chromstålvæv i lærredsvævning fortrinsvis med masketal 200 - 500 mesh og trådtykkelse 5 - 10 μ m kontinuerligt elektrolytisk eller kemisk påføres et nikkellag i en tykkelse på 2 - 20 μ m, og at det således afstivede væv kontinuert forsynes på den ene side med et jævnt lag af en lysfølsom emulsion eller opløsning, idet til dannelse af det jævne lag den lysfølsomme emulsion eller opløsning påføres en jævn, opvarmet, i bevægelse værende flade, og idet under tørringsprocessen for laget den forniklede chromstålvævsbane tilføres lagets bagside og forbindes dermed gennem anbringelse af et yderligere emulsionslag.

Som anordninger hertil anvendes flere neddypningsbade til rensning og affedtning af chromstålvævsbanen og fortrinsvis en negativ-pol kontaktvalse og et elektrolytisk neddypningsbad med en i badet neddyppende, ikke-ledende cylinder, over hvilken chromstålvævsbanen føres til kontinuerlig fornikling. Til fremstilling af det jævne lag af lysfølsomt materiale anvendes en anordning bestående af én eller flere opvarmede, med påføringsanordninger og med tilførringsanordning for chromstålvævsbanen forsynede cylindre.

Det således fremstillede, ensartede væv med jævn overflade egner sig til fremstilling af serigrafitrykcylindre til brug ved kontinuert serigrafi.

